

施設共用におけるALD成膜の ユーザー事例紹介

物質・材料研究機構、東京科学大学、北海道大学、産業技術総合研究所は、令和3年度からスタートした文部科学省委託事業である「マテリアル先端リサーチインフラ事業（ARIM）」の一環として、『施設共用におけるALD成膜のユーザー事例紹介』というオンラインセミナーを2025年8月6日（水）にTeams配信により開催いたします。ARIM共用事業では、これまでの施設利用に加えて利用結果のデータベース化とそれらのデータの利活用が大きな事業目標となっています。今回は、これまでの様々なALD成膜事例についてユーザー様からご紹介いただきます。また、データベースの閲覧環境が整いつつありますので、その閲覧方法やデータカタログの一部を紹介いたします。

◇概要

【日時】令和7年8月6日（水）12:55～17:00

【Teamsによるオンライン配信】 URLは、開催日までに連絡します

【参加費】無料

【定員】200名（先着順、参加登録をお願いします）

【セミナー案内/申し込み】 <https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2025-1/>

【問い合わせ】 tia-npf-school1@aist.go.jp

◇講演プログラム

12:55-13:00 はじめに 産総研ナノプロセッシング施設運営室 松本壮平

13:00-13:20 北海道大学共用施設紹介

北海道大学総合イノベーション創発機構

ナノテクノロジー連携研究推進室 松尾保孝

13:20-13:40 湿式法とALDの融合に基づく酸化ニッケル膜(NiO_x)の作製:

光学・電気化学デバイスへの展開

東北大学多元物質科学研究所 押切友也

13:40-13:50 産総研ナノプロセッシング施設(NPF)のALD実験環境

産総研ナノプロセッシング施設運営室 山崎将嗣

13:50-14:10 ALD酸化チタン(TiO_x)を用いた新型結晶シリコン太陽電池の開発と界面評価

産総研 再生可能エネルギー研究センター 松井卓矢

(裏面へ続く)

◇講演プログラム(続き)

14:10-14:30 アミノシラン原料によるALD法によるSiO₂の成膜特性

メルクエレクトロニクス株式会社 小林明子

14:30-14:50 Cp、アミン系Zr源を使ったZrO₂膜のALD成膜と評価

株式会社トリケミカル研究所 今瀬章公

14:50-15:05 休憩

15:05-15:25 プラズマALDを用いる後工程トランジスタ向け薄膜酸化インジウム(InO_x)チャネルFETs

産総研 先端半導体研究センター Chia-Tsong Chen

15:25-15:45 GaCp*を用いた結晶性GaN膜の原子層堆積

株式会社高純度化学研究所 先端材料研究部 水谷文一

15:45-16:05 ALDで成膜したRu膜のin-situ XPS測定

産総研 先端半導体研究センター 浅沼周太郎

16:05-16:25 SiO₂膜質に対するピュアオゾンガスとプリカーサーの関係

株式会社明電舎先進研究所マテリアルシステム研究部 亀田直人

16:25-16:40 ARIMデータポータルを用いたALD成膜データの利活用

産総研ナノプロセッシング施設運営室 相浦義弘

16:40-16:50 NIMS-ARIM微細加工施設紹介

NIMS 技術開発・共用部門 微細加工ユニット 津谷大樹

16:50-17:00 東京科学大共用施設紹介とALD活用例

東京科学大学 工学院 宮本恭幸

主催:産業技術総合研究所ナノプロセッシング施設(NPF)

主催:物質・材料研究機構 ARIMセンターハブ担当領域推進室

主催:東京科学大学ナノ構造造形支援事業

主催:北海道大学総合イノベーション創発機構 ナノテクノロジー連携研究推進室

お問い合わせ:tia-npf-school1@aist.go.jp